ガラスのレーザスクライブ機構

三星ダイヤモンド工業株式会社

山本幸司

# Laser scribing mechanism of glass

Koji Yamamoto

Mitsuboshi Diamond Industrial Co., Ltd.

1. はじめに

一般的に,ガラス基板は,ガラス表面にスク ライビングホイール<sup>10</sup>でけがき線を形成し,そ のけがき線(以下,スクライブ線という)に沿 って曲げ応力を付加することにより分断され る。このガラス基板の分断方法は,工具を直接 ガラス表面に押し付ける機械的なスクライブ法 であるので,パーティクルの発生が避けられな い。また,分断エッジにマイクロクラックが生 じ,それが起点となってガラス基板が割れる場 合がある<sup>20</sup>。

機械的なスクライブ法に対して,レーザ加熱 により熱応力を発生させ,非接触でスクライブ を行う方法がある。この方法をレーザスクライ ブという。レーザスクライブを用いると,図1 のような滑らかな分断面が得られるので,機械



図1 レーザスクライブの分断面

的なスクライブ法と比べて,パーティクルの発 生が抑制できるとともにガラス基板のエッジ強 度が維持される<sup>3,4)</sup>。このような利点から,レー ザスクライブは,ガラス基板の有効なスクライ ブ法といえる。本稿では,レーザスクライブの 加工メカニズムについて紹介する。

### 2. レーザスクライブ法

まず、レーザスクライブの加工手順を記す。 スクライブを開始するガラス基板端にスクライ ブの起点となる初期亀裂を設け、次に、CO<sub>2</sub>レー

<sup>〒564-0044</sup> 大阪府吹田市南金田 1-4-37 TEL 06-6378-3364 FAX 06-6378-3550 E-mail:kyamamoto@mitsuboshi-dia.co.jp



図2 レーザスクライブの加熱域と冷却域の位置関係

ザを用いて表面で楕円形状となるようにビーム 成形する。初期亀裂生成後,レーザ光をガラス 表面に照射し,レーザ光とガラスに相対的な速 度を設け,スクライブ予定線上を加熱する。レー ザ光の後端付近をウォータージェットにより急 冷する。このような手順で,レーザスクライブ の冷却域において,初期亀裂を進展させ,レー ザスクライブ線を形成する。図2に,レーザビー ムの加熱域とウォータージェットによる冷却域 の位置関係を示す。

## ガラスのレーザスクライブにおける 熱応力解析<sup>5-8)</sup>

レーザスクライブの亀裂進展機構を明らかに するため、板厚0.7mmのソーダガラスに対す るレーザスクライブ可能なレーザ出力 P = 58.7W, スクライブ速度 v=200mm/s の条件で, 有限要素法による三次元熱弾性解析を行った。 ここでは,図2におけるレーザビームによる加 熱域を2x<sub>0</sub>=2.1mm,2y<sub>0</sub>=22mm, ウォーター ジェットによる冷却域を 2x<sub>c</sub>=2mm, 2v<sub>c</sub>=3mm, 冷却点距離 d = 10mm とした。レーザ照射面に x-y座標をとり、y軸とx軸方向をそれぞれ スクライブ方向と板厚方向にとった。レーザス クライブの温度分布と応力分布の解析例を図3 に示す。図3(a)(i),(ii)のように、表面温度 はビーム中心より遅れて最大値に達し、その直 後,冷却され急激に低下する。内部温度は,z が増加するほど加熱と冷却の影響を受けにくく なり、冷却域では表面層だけが冷却されてい



る。これに伴い,図3(b)(i),(ii)のように,表 面近傍では加熱域で圧縮応力が発生し、 直後の 急速冷却よって急激に圧縮応力から引張応力へ 変化する。加熱域の内部では、こが増加して温 度が低下するほど圧縮応力が減少し、逆に引張 応力となっている。冷却直下の内部は圧縮応力 状態にある。これは、表面が急冷されても内部 がまだ高温状態にあるためである。図 3(a)(iii) からわかるように, x-z 面の温度分布は表面だ け冷却され、内部に冷却の影響をそれほど受け ていない高温域が残存する。応力分布は、図3 (b)(iii)のように、冷却されたガラス表面に引 張応力が発生する。内部に残存する高温域が圧 縮応力場となり、表面で発生した引張応力を助 長する。この冷却域表面に発生した大きな引張 応力により亀裂が進展すると考えられる。

#### 4. レーザスクライブ機構

レーザスクライブ機構を図4の模式図を用い て簡単に説明する。レーザ照射によりガラス表 面が加熱され,表面から内部へ熱が伝わる(図



図4 レーザスクライブ機構の模式図

4(b))。レーザ加熱直後にウォータージェット により,表層が冷却される(図4(c))。これに より,冷却域表層で引張応力が発生して亀裂が 進展する。表層だけが冷却されるので,内部に 高温領域が残存する。これが圧縮応力場とな り,表層の引張応力の発生を助長すると考えら れる(図4(c),)。つまり,冷却域で,板厚方 向に温度分布が形成され引張応力が表層に生じ ることによって,レーザスクライブの亀裂が進 展する。

#### 5. おわりに

レーザスクライブは,パーティクル発生の抑 制とガラス基板強度の維持という利点があるの で,ガラス基板の有効な加工法と考えられる。 本稿では,レーザスクライブの熱応力解析例を 紹介するとともに,レーザスクライブ機構につ いて簡単に述べた。また,ガラスのレーザスク ライブにおける板厚と線膨張係数の影響や, レーザクロススクライブ機構に関心のある向き は文献<sup>9-11)</sup>を参照されたい。



図5 レーザスクライバ 12) (三星ダイヤモンド工業 製 MDLC 900)

近年,タッチパネル用ガラス基板の分断工程 に,図5のようなレーザスクライバ<sup>12)</sup>(三星ダ イヤモンド工業製 MDLC 900)が適用され,レー ザスクライブ技術が導入されている。技術進化 とともに,レーザスクライブにおいても,さら なる技術開発を進める必要があると考えてい る。

#### 参考文献

- 1) 例えば、三星ダイヤモンド工業株式会社製品カタロ グ、(2004).
- 2) 渡部紀夫,ガラス工学ハンドブック,朝倉書店,392 (1999).
- 三宅泰明, FPD ガラス基板の切断技術, 砥粒加工学 会誌, 45-7, 342 (2001).
- C. Hermanns,Laser Separation of Flat Glass, Proc. 63 rd Laser Mater. Processing Conf., Jpn. Laser Processing. Soc., 105 (2005).
- 5)山本幸司,羽阪 登,森田英毅,大村悦二,ガラスの レーザスクライブにおける熱応力解析,精密工学会

誌,71-9,1157 (2005).

- 6)山本幸司,羽阪 登,森田英毅,大村悦二,ガラスの レーザスクライブにおける三次元熱応力解析,日本機 械学会論文集,C編,72-724,3927 (2006).
- K.Yamamoto, N.Hasaka, H.Morita, and E.Ohmura, Three Dimensional Thermal Stress Analysis on Laser Scribing of Glass, Precision Engineering, 32–4, 301 (2008).
- K.Yamamoto, N.Hasaka, H.Morita, and E.Ohmura, Thermal Stress Analysis on Laser Scribing of Glass, Journal of Laser Applications, 20–4, 193 (2008).
- 9) 山本幸司,羽阪 登,森田英毅,大村悦二,ガラスの レーザスクライブにおける板厚の影響,レーザ加工学 会誌,15-4,270 (2008).
- 10) 山本幸司,羽阪 登,森田英毅,大村悦二,ガラスの レーザスクライブにおける線膨張係数の影響,レーザ 加工学会誌,15-4,277 (2008).
- 11)山本幸司,羽阪 登,森田英毅,大村悦二:ガラスの レーザクロススクライブにおける熱応力解析,精密工 学会誌,74-9,937 (2008).
- 12) 例えば,三星ダイヤモンド工業株式会社製品カタロ グ,(2009).